



KINTEK SOLUTION

Cvd-Diamantmaschine Katalog

Kontaktieren Sie uns für weitere Kataloge von **Probenvorbereitung, Thermische Ausrüstung, Verbrauchsmaterialien und Materialien für das Labor, Biochemische Ausrüstung, etc...**

KINTEK SOLUTION

UNTERNEHMENSPROFIL

>>> Über uns

Kintek Solution Ltd ist eine technologieorientierte Organisation. Die Teammitglieder widmen sich der Erforschung der effizientesten und zuverlässigsten Technologie und Innovationen in der wissenschaftlichen Forschungsausrüstung, in Bereichen wie biochemischen Reaktionen, Erforschung neuer Materialien, Wärmebehandlung, Vakuumherzeugung, Kühlung sowie in der Pharmaindustrie und Ausrüstung zur Erdölförderung.

In den letzten 20 Jahren haben wir umfangreiche Erfahrungen auf diesem Gebiet der Forschungsausrüstung gesammelt. Wir sind in der Lage, sowohl die Ausrüstung als auch die Lösung gemäß den Bedürfnissen und Gegebenheiten unserer Kunden zu liefern. Wir haben auch viele Kundenausrüstungen entwickelt, die auf einen bestimmten Arbeitszweck zugeschnitten sind. Wir haben viele erfolgreiche Projekte an vielen Universitäten und Instituten in verschiedenen Ländern, wie Asien, Europa, Nord- und Südamerika, Australien und Neuseeland, dem Nahen Osten und Afrika.

Professionalität, schnelle Reaktionsfähigkeit, Fleiß und Aufrichtigkeit zeichnen die Arbeitseinstellung unserer Teammitglieder aus und verschaffen uns einen guten Ruf bei unseren Kunden.

Wir sind hier und bereit, unsere Kunden aus verschiedenen Ländern und Regionen zu bedienen und gemeinsam die effizienteste und zuverlässigste Technologie zu teilen!



Zylindrischer Resonator Mpcvd-Diamant-Maschine Für Labor-Diamant Wachstum

Artikelnummer: KTWB315



Introduction

Informieren Sie sich über die MPCVD-Maschine mit zylindrischem Resonator, das Verfahren der chemischen Gasphasenabscheidung mit Mikrowellenplasma, das für die Herstellung von Diamantsteinen und -filmen in der Schmuck- und Halbleiterindustrie verwendet wird. Entdecken Sie die kosteneffektiven Vorteile gegenüber den traditionellen HPHT-Methoden.

[Mehr erfahren](#)

| | |
|--------------------|--|
| Mikrowellen-System | <ul style="list-style-type: none"> • Mikrowellenfrequenz 2450±15MHZ, • Ausgangsleistung 10 KW stufenlos einstellbar • Stabilität der Mikrowellenausgangsleistung: <±1% • Mikrowellenstreuung ≤2MW/cm2 • Ausgangswellenleiter-Schnittstelle: WR340, 430 mit FD-340, 430 Standardflansch • Kühlwasserdurchfluss: 6-12L/min • Stehwellenkoeffizient des Systems: VSWR ≤ 1,5 • Manueller 3-Pin-Mikrowelleneinsteller, Erregerkavität, Hochleistungslast • Eingangsstromversorgung: 380VAC/50Hz ± 10%, dreiphasig |
| Reaktionskammer | <ul style="list-style-type: none"> • Vakuum-Leckagerate < 5 × 10⁻⁹ Pa .m3/s • Der Grenzdruck ist kleiner als 0,7 Pa (Standardeinstellung mit Pirani-Vakuummeter) • Der Druckanstieg der Kammer darf 50 Pa nach 12 Stunden Druckhaltung nicht überschreiten • Arbeitsmodus der Reaktionskammer: TM021 oder TM023 Modus • Art des Hohlraums: Zylindrischer Resonanzhohlraum, mit einer maximalen Tragkraft von 10KW, hergestellt aus Edelstahl 304, mit wassergekühlter Zwischenschicht und hochreinem Quarzplatten-Dichtungsverfahren. • Lufteinlass-Modus: Oberer ringförmiger gleichmäßiger Lufteinlass • Vakuumversiegelung: Der untere Anschluss der Hauptkammer und die Injektionsklappe sind mit Gummiringen abgedichtet, die Vakuumpumpe und der Faltenbalg sind mit KF abgedichtet, die Quarzplatte ist mit einem Metall-C-Ring abgedichtet, und der Rest ist mit CF abgedichtet • Fenster zur Beobachtung und Temperaturmessung: 8 Beobachtungsöffnungen • Probenladeöffnung an der Vorderseite der Kammer • Stabile Entladung innerhalb des Druckbereichs von 0,7KPa~30KPa (der Leistungsdruck muss angepasst werden) |
| Probenhalter | <ul style="list-style-type: none"> • Durchmesser des Probentisches ≥ 72mm, effektive Nutzfläche ≥ 66 mm • Grundplattenplattform in wassergekühlter Sandwichbauweise • Probenhalter kann gleichmäßig elektrisch im Hohlraum angehoben und abgesenkt werden |
| Gasfluss-System | <ul style="list-style-type: none"> • Ganzmetall-Schweißluftscheibe • Für alle internen Gaskreisläufe des Geräts sind Schweiß- oder VCR-Verbindungen zu verwenden. • 5 Kanäle MFC-Durchflussmesser, H2/CH4/O2/N/Ar. H2: 1000 sccm; CH4: 100 sccm; O2: 2 sccm; N2: 2 sccm; Ar: 10 sccm • Arbeitsdruck 0,05-0,3MPa, Genauigkeit ± 2% • Unabhängige pneumatische Ventilsteuerung für jeden Kanal-Durchflussmesser |
| Kühlsystem | <ul style="list-style-type: none"> • 3 Linien Wasserkühlung, Echtzeit-Überwachung von Temperatur und Durchfluss. • Der Kühlwasserdurchfluss des Systems ist ≤ 50L/min • Der Kühlwasserdruck ist < 4KG, und die Wassereintrittstemperatur ist 20-25 °C. |

- Temperatursensor
- Das externe Infrarot-Thermometer hat einen Temperaturbereich von 300-1400 °C.
 - Genauigkeit der Temperaturregelung < 2 °C oder 2%

- Steuerungssystem
- Siemens smart 200 PLC und Touchscreen-Steuerung sind angenommen.
 - Das System verfügt über eine Vielzahl von Programmen, die das automatische Gleichgewicht der Wachstumstemperatur, die genaue Kontrolle des Wachstums Luftdruck, automatische Temperaturerhöhung, automatische Temperaturabfall und andere Funktionen realisieren können.
 - Durch die Überwachung von Wasserdurchfluss, Temperatur, Druck und anderen Parametern kann ein stabiler Betrieb der Anlage und ein umfassender Schutz der Anlage erreicht werden, und die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Betriebs kann durch funktionale Verriegelung gewährleistet werden.

- Optionale Funktion
- Zentrales Überwachungssystem
 - Substrat basierende Leistung

Glockenglas-Resonator-Mpcvd-Maschine Für Labor- Und Diamantwachstum

Artikelnummer: KTMP315



Introduction

Erhalten Sie hochwertige Diamantfilme mit unserer Bell-jar-Resonator-MPCVD-Maschine, die für Labor- und Diamantwachstum konzipiert ist. Entdecken Sie, wie die chemische Gasphasenabscheidung mit Mikrowellenplasma beim Züchten von Diamanten mithilfe von Kohlenstoffgas und Plasma funktioniert.

[Mehr erfahren](#)

| | |
|-------------------|---|
| Mikrowellensystem | <ul style="list-style-type: none"> • Mikrowellenfrequenz 2450 ± 15 MHz, • Ausgangsleistung 1~10 KW stufenlos einstellbar • Stabilität der Mikrowellen-Ausgangsleistung: • Mikrowellenleckage ≤ 2 MW/cm² • Ausgangswellenleiterschnittstelle: WR340, 430 mit FD-340, 430 Standardflansch • Kühlwasserdurchfluss: 6-12 l/min • Stehwellenkoeffizient des Systems: VSWR $\leq 1,5$ • Manueller Mikrowellen-3-Pin-Einsteller, Anregungshohlraum, Hochleistungslast • Eingangsstromversorgung: 380 VAC/50 Hz ± 10 %, dreiphasig |
| Reaktionskammer | <ul style="list-style-type: none"> • Vakuumleckrate • Der Grenzdruck beträgt weniger als 0,7 Pa (Standardkonfiguration mit Pirani-Vakuummeter) • Der Druckanstieg in der Kammer darf nach 12 Stunden Druckhaltung 50 Pa nicht überschreiten • Arbeitsmodus der Reaktionskammer: TM021- oder TM023-Modus • Hohlraumtyp: Butterfly-Resonanzhohlraum mit einer maximalen Lagerleistung von 10 kW, hergestellt aus Edelstahl 304, mit wassergekühlter Zwischenschicht und hochreiner Quarzplatten-Versiegelungsmethode. • Lufteinlassmodus: Oberer ringförmiger gleichmäßiger Lufteinlass • Vakuumabdichtung: Der untere Anschluss der Hauptkammer und die Einspritztür sind mit Gummiringen abgedichtet, die Vakuumpumpe und der Balg sind mit KF abgedichtet, die Quarzplatte ist mit einem Metall-C-Ring abgedichtet und der Rest ist mit CF abgedichtet • Beobachtungs- und Temperaturmessfenster: 4 Beobachtungsöffnungen • Probenladeanschluss vor der Kammer • Stabile Entladung im Druckbereich von 0,7 kPa bis 30 kPa (der Leistungsdruck muss angepasst sein) |
| Beispiel halter | <ul style="list-style-type: none"> • Durchmesser des Probenhalters ≥ 70 mm, effektive Nutzungsfläche ≥ 64 mm • Wassergekühlte Sandwich-Struktur der Grundplattenplattform • Der Probenhalter kann in der Kavität gleichmäßig elektrisch angehoben und abgesenkt werden |
| Gasflusssystem | <ul style="list-style-type: none"> • Ganzmetall-Schweißluftscheibe • Für alle internen Gaskreisläufe des Geräts müssen Schweiß- oder VCR-Verbindungen verwendet werden. • 5 Kanäle MFC-Durchflussmesser, H₂/CH₄/O₂/N/Ar. H₂: 1000 sccm; CH₄: 100 sccm; O₂: 2 sccm; N₂: 2 sccm; Ar: 10 sccm • Arbeitsdruck 0,05-0,3 MPa, Genauigkeit ± 2 % • Unabhängige pneumatische Ventilsteuerung für jeden Kanal-Durchflussmesser |
| Kühlsystem | <ul style="list-style-type: none"> • 3 Leitungen Wasserkühlung, Echtzeitüberwachung von Temperatur und Durchfluss. • Der Kühlwasserdurchfluss des Systems beträgt ≤ 50 l/min • Der Kühlwasserdruck beträgt |
| Temperatursensor | <ul style="list-style-type: none"> • Das externe Infrarot-Thermometer hat einen Temperaturbereich von 300-1400 °C • Genauigkeit der Temperaturregelung |

| | |
|--------------------|---|
| Kontrollsystem | <ul style="list-style-type: none">• Siemens Smart 200 SPS und Touchscreen-Steuerung werden übernommen.• Das System verfügt über eine Vielzahl von Programmen, mit denen ein automatischer Ausgleich der Wachstumstemperatur, eine genaue Steuerung des Wachstumsluftdrucks, ein automatischer Temperaturanstieg, ein automatischer Temperaturabfall und andere Funktionen realisiert werden können.• Durch die Überwachung des Wasserdurchflusses, der Temperatur, des Drucks und anderer Parameter können ein stabiler Betrieb der Geräte und ein umfassender Schutz der Geräte erreicht werden, und die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Betriebs kann durch funktionale Verriegelung gewährleistet werden. |
| Optionale Funktion | <ul style="list-style-type: none">• Center-Überwachungssystem• Substratbasierte Leistung |

Ziehdüse Mit Nano-Diamantbeschichtung, Hfcdv-Ausrüstung

Artikelnummer: MP-CVD-100



Introduction

Das Ziehwerkzeug für die Nano-Diamant-Verbundbeschichtung verwendet Sinterkarbid (WC-Co) als Substrat und nutzt die chemische Gasphasenmethode (kurz CVD-Methode), um die herkömmliche Diamant- und Nano-Diamant-Verbundbeschichtung auf die Oberfläche des Innenlochs der Form aufzubringen.

[Mehr erfahren](#)

Vergleichstabelle zwischen herkömmlichen und nanodiamantbeschichteten Ziehsteinen

Technische Zusammensetzung von HFCVD

| Technische Parameter | Zusammensetzung der Ausrüstung | Systemkonfiguration |
|--|--|--|
| Glasglocke: Durchm. 500 mm, Höhe 550 mm, Kammer aus Edelstahl SUS304; innere Edelstahlahtisolierung, Hubhöhe beträgt 350 mm; | Ein Satz Hauptkörper der Vakuumkammer (Glocke) (ummantelte Wasserkühlungsstruktur) | Hauptkörper der Vakuumkammer (Glocke); Der Hohlraum besteht aus hochwertigem Edelstahl 304; Vertikale Glasglocke: Der ummantelte Wasserkühlmantel ist am gesamten Umfang der Glasglocke angebracht. Die Innenwand der Glasglocke ist mit einer Edelstahlaht isoliert und die Glasglocke ist seitlich befestigt. Genaue und stabile Positionierung; Beobachtungsfenster: horizontal in der Mitte der Vakuumkammer angeordnet. 200-mm-Beobachtungsfenster, Wasserkühlung, Prallplatte, seitliche und obere Konfiguration, 45-Grad-Abschrägungswinkel, 50°-Beobachtungsfenster (beobachten Sie den gleichen Punkt wie das horizontale Beobachtungsfenster und die Proben tragplattform); Die beiden Beobachtungsfenster behalten die bestehende Position und Größe bei. Der Boden der Glasglocke ist 20 mm höher als die Ebene der Bank, eingestellte Kühlung; Die im Flugzeug reservierten Löcher, wie z. B. große Ventile, Entlüftungsventile, Luftdruckmessung, Bypassventile usw., sind mit Metallgitter abgedichtet und für die Installation der Elektrodenanschlüsse reserviert. |
| Gerätetisch: L1550* B900*H1100mm | Ein Satz Schleppprobentischgeräte (mit Doppelachsenantrieb) | Probenhaltergerät: Probenhalter aus Edelstahl (Schweißwasserkühlung), 6-Positionen-Gerät; Es kann separat eingestellt werden, nur nach oben und unten verstellbar, der Einstellbereich nach oben und unten beträgt 25 mm, und das linke und rechte Schütteln muss beim Auf- und Abfahren weniger als 3 % betragen (d. h. das linke und rechte Schütteln von). Das Ansteigen oder Absenken um 1 mm beträgt weniger als 0,03 mm und der Probentisch dreht sich beim Anheben oder Absenken nicht. |
| Endvakuumgrad: 2,0x10 ⁻¹ Pa; | Eine Reihe von Vakuumsystemen | Vakuumsystem: Konfiguration des Vakuumsystems: mechanische Pumpe + Vakuumventil + physisches Entlüftungsventil + Hauptabgasrohr + Bypass; (vom Vakuumpumpenlieferanten bereitgestellt), das Vakuumventil verwendet ein pneumatisches Ventil; Vakuumsystemmessung: Membrandruck. |
| Druckanstiegsrate: ≤5Pa/h; | Zweikanaliges Massendurchflussmesser-Gasversorgungssystem | Gasversorgungssystem: Der Massendurchflussmesser wird von Partei B konfiguriert, Zwei-Wege-Lufteinlass, die Durchflussrate wird durch den Massendurchflussmesser gesteuert, nach dem Zwei-Wege-Treffen gelangt er von oben in die Vakuumkammer und von innen des Lufteinlassrohrs beträgt 50 mm |
| Bewegung des Probentisches: Auf- und Abwärtsbereich beträgt ± 25 mm; Es ist erforderlich, das Verhältnis von links und rechts beim Auf- und Abwärtsfahren um ± 3 % zu schütteln. | Ein Satz Elektrodengerät (2 Kanäle) | Elektrodengerät: Die Längsrichtung der vier Elektrodenlöcher verläuft parallel zur Längsrichtung der Stützplattform und die Längsrichtung zeigt zum Hauptbeobachtungsfenster mit einem Durchmesser von 200 mm. |
| Arbeitsdruck: Membranmanometer-Manometer verwenden, Messbereich: 0 ~ 10 kPa; Arbeitskonstante bei 1 kPa ~ 5 kPa, der konstante Druckwert ändert sich um plus oder minus 0,1 kPa; | Eine Reihe von Kühlwassersystemen | Kühlwassersystem: Die Glocke, die Elektroden und die Bodenplatte sind alle mit Kühlleitungen für zirkulierendes Wasser und mit einem Alarmgerät für unzureichenden Wasserdurchfluss ausgestattet. 3.7: Steuersystem. Schalter, Instrumente, Instrumente und Stromversorgung für Glockenanheben, Luftablass, Vakuumpumpe, Hauptstraße, Bypass, Alarm, Durchfluss, Luftdruck usw. sind an der Seite des Ständers angebracht und werden über einen 14-Zoll-Touchscreen gesteuert ; Das Gerät verfügt über ein vollautomatisches Steuerprogramm ohne manuelle Eingriffe und kann Daten und Anrufrufen speichern |

| | |
|---|---|
| Position des Lufteinlasses: Der Lufteinlass befindet sich oben an der Glasglocke und die Position der Auslassöffnung befindet sich direkt unter dem Probenhalter. | Kontrollsystem |
| Steuerungssystem: SPS-Steuerung + 10-Zoll-Touchscreen | Ein Satz automatischer Druckregelsysteme (originales Druckregelventil aus Deutschland importiert) |
| Aufblssystem: 2-Kanal-Massendurchflussmesser, Durchflussbereich: 0-2000 sccm und 0-200 sccm; Pneumatisches Ventilventil | Widerstandsvakuummeter |
| 3.1.10 Vakuumpumpe: D16C Vakuumpumpe | |

| Technische Indikatoren | Traditioneller Zeichenstempel | Ziehmatrize mit Nanodiamantbeschichtung |
|---|---|---|
| Korngröße der Beschichtungs Oberfläche | keiner | 20-80nm |
| Diamantgehalt der Beschichtung | keiner | ≥99 % |
| Dicke der Diamantbeschichtung | keiner | 10 ~ 15 mm |
| Oberflächenrauheit | Ra≤0,1mm | Klasse A: Ra≤0,1 mm Klasse B: Ra≤0,05 mm |
| Bereich des Innenlochdurchmessers der Beschichtungziehmatrize | Φ3 ~ Φ70mm | Φ3 ~ Φ70mm |
| Lebensdauer | Die Lebensdauer hängt von den Arbeitsbedingungen ab | 6-10 mal länger |
| Oberflächenreibungskoeffizient | 0,8 | 0,1 |

915Mhz Mpcvd Diamant-Maschine

Artikelnummer: MP-CVD-101



Introduction

915MHz MPCVD-Diamant-Maschine und seine Multi-Kristall effektives Wachstum, die maximale Fläche kann 8 Zoll erreichen, die maximale effektive Wachstumsfläche von Einkristall kann 5 Zoll erreichen. Diese Ausrüstung wird hauptsächlich für die Produktion von großformatigen polykristallinen Diamantfilmen, das Wachstum von langen Einkristalldiamanten, das Niedertemperaturwachstum von hochwertigem Graphen und anderen Materialien verwendet, die Energie benötigen, die durch Mikrowellenplasma für das Wachstum bereitgestellt wird.

[Mehr erfahren](#)

| | |
|--|--|
| <p>Mikrowellensystem (je nach optionaler Stromversorgung)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsfrequenz:915±15MHz • Ausgangsleistung:3-75kW stufenlos einstellbar • Kühlwasserdurchfluss:120/min • Stehwellenkoeffizient des Systems: VSWR≤1,5 • Mikrowellenleckage: <2mw/cm2 |
| <p>Vakuumsystem und Reaktionskammer</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Leckagerate <5×10-9Pa.m3/s • Der Enddruck beträgt weniger als 0,7Pa (diese Maschine wird mit einem importierten Pirani-Vakuummeter geliefert) • Der Druckanstieg im Hohlraum darf nach 12 Stunden Druckaufrechterhaltung 50Pa nicht überschreiten. • Arbeitsmodus der Reaktionskammer: TM021 oder TM023 Modus • Hohlraumtyp: gekühlter zylindrischer Hohlraum, kann Leistung bis zu 75KW tragen, hohe Reinheit, Steinringdichtung. • Einlass-Methode: Top Sprinklerkopf Einlass. • Beobachtung Temperaturmessung Fenster: 8 Beobachtungslöcher, gleichmäßig horizontal verteilt. • Probenentnahme: Probenentnahmeöffnung unten |
| <p>Probenhalter-System</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Probenbüchsendurchmesser ≥200mm, Einkristall Nutzfläche ≥130mm, Die Nutzfläche von polykristallinen ist ≥200mm. Substratplattform wassergekühlte Sandwich-Struktur, vertikal gerade nach oben und unten. |
| <p>Gasanlage</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Vollmetall geschweißte Gasplatte 5-7 Gasleitungen • Alle internen Luftkreise des Geräts verwenden Schweiß- oder VCR-Anschlüsse. |

| | |
|--|---|
| Kühlung des Systems | <ul style="list-style-type: none"> • 3-Wege-Wasserkühlung, Echtzeit-Überwachung von Temperatur und Durchfluss. • Systemkühlwasserdurchfluss 120L/min, Kühlwasserdruck <4KG, Wassereintrittstemperatur 20-25. |
| Verfahren zur Temperaturmessung | <ul style="list-style-type: none"> • Externes Infrarot-Thermometer, Temperaturbereich 3001400 M |

| Seriennummer | Name des Moduls | Bemerkung |
|--------------|--|--|
| 1 | Mikrowellen-Stromversorgung | Standard-Inlandsmagnetron: Yingjie Electric / Distinguish-Stromversorgung Inländische Halbleiterquelle: Watson (+30.000) Importiertes Magnetron: MKS/Pastoral (+100.000) |
| 2 | Hohlleiter, drei Stifte, Modenwandler, oberer Resonator | Selbst gemacht |
| 3 | Vakuumreaktionskammer (obere Kammer, untere Kammer, Anschlüsse) | Selbst hergestellt |
| 4 | Infrarot-Thermometer, optische Verschiebungselemente, Halterungen | Infrarot-Thermometer, optische Verschiebungselemente, Fuji Gold Siemens + Schneider Halterungen |
| 5 | Wasserkühlung von Komponenten für Tischbewegungen (Zylinder, Werkstücke usw.) | |
| 6 | Keramisches Dünnschicht-Vakuummeter, Pirani-Vakuummeter | Inficon |
| 7 | Komponenten für Vakuumventile (Ultrahochvakuum-Schieberventil, pneumatisches Präzisionsventil*2, elektromagnetisches Vakuumdifferenzialventil) | Fujikin + Zhongke + Himat |
| 8 | Vakuumpumpe und Anschlussleitungen, T-Stück, KF25-Faltenbalg*2, Adapter | Pumpe: Flyover 16L |
| 9 | Metall-Mikrowellen-Dichtungsring*2; Metall-Vakuum-Dichtungsring*1; Quarzplatte | Quarz: Shanghai FeilihuaSemiconductor Grade High Purity Quartz |
| 10 | Komponenten für zirkulierendes Wasser (Gelenke, Umlenklöcke, Durchflussdetektoren) | Japanisches SMC/CKD |
| 11 | Pneumatisches Teil (CKD-Filter, Airtac-Mehrwege-Magnetventil, Rohrverbindungen und Adapter) | |
| 12 | Gasanschluss, EP-Gasleitung, VCR-Anschluss, Filter 0,0023µm *1, Filter 10µm*2 | Fujikin |
| 13 | Maschinengehäuse, Tisch aus rostfreiem Stahl, Universalräder, Füße, Befestigungsschrauben für die Halterung, usw. | Sonderanfertigung |
| 14 | Gasdurchflussmesser*6 (einschließlich einer Druckregelung) | Standard Sieben-Sterne, optional Fuji Gold (+34.000) / Alicat (42.000) |
| 15 | Gasplattenverarbeitung (5-Wege-Gas, Filter*5, Pneumatikventil*5, Handventil*6, Rohrleitungsschweißen) | Fuji Gold |
| 16 | Automatische PLC-Steuerung | Siemens und Schneider |
| 17 | Molybdän-Tisch | |



Kintek Solution

Hauptsitz: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China
Büro in Hongkong: 300 Lockhart Road, Wan Chai,
Hongkong
Kanada-Büro: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P
2C7, Kanada

